

ERL計画推進室報告

2016年4月26日

河田洋

- cERLの出口戦略に関して
 - EUVL Symposiumへの講演
 - TIA「かけはし」でコンセンサス作りの活動
 - JSTへの働きかけ
- ERL総括委員会

cERLの出口戦略に関して

- cERLの本格調整運転に関しては、来年度見通せない状況（放射光からの次期計画の位置付けの欠如）。
- その中で、機構長からは出口戦略を企業との連合によるEUV光源開発を軸に検討すべきとの指示があり。
- 経済産業省への働きかけのための資料作りを開始。



PIPでも社会貢献への新しい応用に向けて検討

経産省およびIntelとの会合報告(4)

- 両者の会合から見えてきた事

○ASLMと正式なチャンネルを取り交わして、ASLMに本開発計画を後押ししてもらうように働きかける必要があるだろう。

○国際的なマーケットが対象となるので、国際的な半導体産業におけるEUV-FELの開発のマイルストーンの中に、本プロト機の開発計画は位置付けられていることが必要。



秋に広島で行われるEUVL Symposiumで上のような雰囲気作りを働きかけることが近々のアクションプランか？

国際会議、ワークショップへの講演

- 6月13 -16日に米国で開催されたEUVL Workshop
<http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1101919912805&ca=a5ae487c-345e-41b0-80ed-8eccb435be28>
 - 加藤龍好教授：“The Design and Development of a 10-kW Class EUV-FEL Project in Japan”
- 10月24-26日に広島で開催される「EUVL Symposium 2016」 <http://euvl2016.org/>
 - 中村典雄氏：ERL-based High-power FEL Source for EUV Lithography
 - 河田：Strategy to realize the EUV-FEL high power light source
- Present status on the EUV-FEL R&D activities -